

サンビーム 発表内容

ポスター発表 9月6日(金)			
S-01	本谷 宗	三菱電機(株)	微小角入射 X 線回折を用いた ZnO 薄膜の深さ方向結晶構造解析
S-02	上原 康	三菱電機(株)	エポキシ共重合体の高次構造形成過程解析
S-03	淡路 直樹	(株)富士通研究所	臨界角一定制御 XAFS 測定技術
S-04	青木 潤珠	日立マクセル(株)	リチウム電池正極材料における高電圧劣化モードでの構造解析
S-05	大園 洋史	パナソニック(株)	リチウム過剰固溶体正極材料の充放電過程における反応機構解析
S-06	久保 潤啓	(株)日産アーク	In situ XAS と第一原理計算によるリチウムイオン電池正極材料の反応解析
S-07	高橋 伊久磨	日産自動車(株)	リチウムイオン二次電池正極材料の XAFS 解析
S-08	垣内 孝宏	日産自動車(株)	Pt/Au コアシェル型触媒の in situ XAFS 解析
S-09	吉田 泰弘	日亜化学工業(株)	放射光を用いたリチウムイオン二次電池正極材料サイクル劣化構造解析
S-10	吉成 篤史	日亜化学工業(株)	LED 高品質化に向けた AlN バッファ層の影響評価
S-11	高橋 直子	(株)豊田中央研究所	Cs→Pr 系元素変換の検証実験
S-12	小坂 悟	(株)豊田中央研究所	リサイクル Mg 合金中における微量 Cl の蛍光 X 線分析
S-13	山口 聡	(株)豊田中央研究所	放射光トポグラフィによる SiC エピタキシャル膜中の転位の観察
S-14	沖 充浩	(株)東芝	ガラス中添加剤の価数評価
S-15	秋保 広幸	(一財)電力中央研究所	酸化反応を利用した水溶性セレンの分別定量法の開発
S-16	橋上 聖	関西電力(株)	高温還元雰囲気下におけるセリア系酸化物の局所構造の評価
S-17	細井 慎	ソニー(株)	In 系透明酸化物半導体の XAFS 解析
S-18	越谷 直樹	ソニー(株)	有機半導体薄膜の X 線回折法による構造解析
S-19	米村 卓巳	住友電気工業(株)	斜出射 XAFS による半導体/絶縁被膜界面の状態評価手法の検討
S-20	稲葉 雅之	(株)神戸製鋼所	サンビームにおけるその場 XAFS 測定の取組み
S-21	日比野 真也	川崎重工業(株)	先進アルミ合金の加工・熱処理における結晶構造変化の評価
S-22	飯原 順次	回折装置 SG	CdTe 検出器を用いた高エネルギー X 線回折
S-23	巽 修平	大型設備立上げ PJ	サンビーム大型設備導入 ～硬 X 線光電子分光装置・多次元 X 線検出器